## ⑲ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

# @ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-108782

⑤Int.Cl.5 識別記号 庁内整理番号 ④公開 平成4年(1992)4月9日 C 07 D 307/33 B 01 J 31/24 // C 07 B 53/00 B 8217-4H 61/00 3 0 0 6971-4C C 07 D 307/32 F 審査請求 未請求 請求項の数 2 (全8頁)

**9発明の名称** 光学活性 アーブチロラクトン誘導体の製造方法

②特 頤 平2-228957

②出 願 平2(1990)8月30日

愛知県愛知郡日進町大字梅森字新田135-417 良 治 加発明 者 野 依 愛知県名古屋市千種区春里町2-4 雅 人 北 村 個発 明 者 群馬県前橋市大利根町1-22-2 明 大 熊 殺 79発 者 東京都大田区蒲田5-36-31 株式会社高砂リサーチ・イ 昇 用 72)発 明 者 ンステイテユート内 東京都大田区蒲田 5-36-31 株式会社高砂リサーチ・イ 秀徳 個発 明 者 ンステイテユート内 東京都港区高輪3丁目19番22号 ⑪出 顧 人 高砂香料工業株式会社

個代 理 人 弁理士 有賀 三幸 外2名

#### 明 紐 曹

1 発明の名称

光学活性ェーブチロラクトン誘導体の製造方法

- 2. 特許請求の範囲
  - 1. 一般式(1)

(式中、 R'は炭素数 1 ~10の アルキル 基又は置換 基を有してもよいフェニル基を示し、 R\*は水素原 子又は低級 アルキル基を示す。)

で表わされる r ーケト酸又はそのエステルを光学 活性ルテニウムーホスフィン錯体を触媒として不 斉水素化させることを特徴とする一般式( II)

(式中、 R'は前記と同じ意味を示し、\* 印は不斉 炭素を示す。)

で表わされる光学活性 r ープチロラクトン誘導体の製造方法。

- 2. 光学活性ルテニウムーホスフィン錯体が、次の (1) ~ (3)
  - (1) 一般式(皿)

Ru H , CL = (R 2 - BINAP) = (Q) , ( 11 )

(式中、R³-8INAPは次式 (Ⅳ)

で表わされる三級ホスフィン(ここで、 R\*は水森原子、メチル基又はtertーブチル基を示す)を示し、 Q は三級アミンを示し、 y は Q 又は 1 を示し、 y か 0 のときx は 2、 z は 4、 p は 1 を示し、 y が 1 のときはx は 1、 z は 1、 p は 0 を示す。)
(2) 一般式 (V)

であわされる三級ホスフィン(ここで、 R\*は前記と同じ意味を示す)を示し、 R\*は低級アルキル基、ハロゲン化低級アルキル基又はフェニル基を示す。)

#### (3) 一般式(VI)

$$[RuX(\frac{R^{5}}{R^{5}}P-R^{6})(R^{7}-BINAP)]_{2}(\mu-X)_{2}$$
 (VI)

(式中、X はハロゲン原子を示し、R\*及びR\*は同

### 一般式 ( [ )

(式中、R'は炭素数1~10のアルキル基又は置換 基を有してもよいフェニル基を示し、\* 印は不斉 炭素を示す。)

で表わされる光学活性 ラクトンには、それ自体理々の昆虫フェロモンとして、また香料として重要なものが多く、その合成方法としては 1) 光学活性な天然物を出発原料とする方法 (Agric. Biol.

Chem., <u>61</u>. 635(1987))、2)<sub>T</sub> ーケト酸の酵母による還元で合成する方法(Appl. Microbiol., <u>11</u>. 389(1963))、3) ラセミ体を光学分割する方法(特開昭55-43053号公報)等が知られている。

尚、ァーブチロラクトンのラセミ体の製造方法 としては、マレイン酸及び/又は無水マレイン酸 をルテニウムの塩化ホスホニウム、第1~第3級 ホスフィン塩酸塩又は第4級ホスホニウム塩酸塩 等のルテニウム烛媒の存在下、水素化することに 一又は異なって置換器を有してもよいフェニル器 を示し、R\*-BINAPは一般式(VII)

で表わされる三級ホスフィンを示し、ここでR'は 水素原子、メチル基、tertーブチル基又はメトキ シ基を示す。)

で表わされる化合物より選ばれる1種である請求項1記載の製造方法。

## 3. 発明の辞細な説明、

#### 〔産業上の利用分野〕

本発明は、機々の昆虫フェロモンとして、また 香料として重要である光学活性 r ーブチロラクト ン誘導体の製造方法に関する。

〔従来の技術〕

よりァーブチロラクトンを製造する方法 (特開平 2-200680号公報) 等が知られている。

#### [発明が解決しようとする課題]

しかしながら、天然物を出発原料とする方法では工程数が多く、操作も煩雑である。また微生物による方法では未だ高い光学純度のものが得られていない。さらに光学分割による方法では当量の光学活性体を必要とする他、分割効率が悪い等の問題点があった。従ってより簡単で工程数が少なく、さらに光学純度の良好な目的化合物を得ることのできる合成法が望まれていた。

## [課題を解決するための手設]

このような実情において本発明者らは上記問題点を解決しようと鋭意研究を行った結果、比較的安価な光学活性ルテニウム触媒を使用して、アーケト酸又はそのエステルの不斉水素化を行うことにより光学純度の高いラクトン(Ⅱ)が簡単に、少ない工程数で得られることを見出し本発明を完成した。

本発明の製造方法は、次の反応式によって示さ

ns.

(式中、R'は前記と同じ意味を示し、R'は水景原子又は低級アルキル基を示し、\* 印は不斉炭素を示す。)

すなわち、一般式 ( [ ) で表わされる r ーケト 酸又はそのエステルを光学活性ルテニウムーホス フィン群体を触媒として不斉水素化することを特 嵌とする、一般式 ( I ) で表わされる光学活性 r ーブチロラクトン誘導体の製造方法である。

本発明で使用する出発原料のアーケト酸又はモのエステル(I)は適常、Jean Mathieu. Jean Weill-Rayal 著"Formation of C-C Bonds"(1979) Georg Thieme Publishers Stuttgart P. 374に示される方法により簡単に合成できる。

で扱わされる三級ホスフィン(ここで、R<sup>3</sup>は水衆原子、メチル基又はtertーブチル基を示す)を示し、Q は三級アミンを示し、y は 0 又は 1 を示し、y が 0 のとき x は 2 、 z は 4 、 p は 1 を示し、y が 1 のときは x は 1 、 z は 1 、 p は 0 を示す。)
(2) 一般式 (V)

てーケト酸又はそのエステル(1)としてはレブリン酸、 4 ー オキソヘキサン酸、 4 ー オキソトプタン酸、 4 ー オキソデカン酸、 4 ー オキソドデカン酸、 4 ー オキソデカン酸、 4 ー フェニルー 4 ー オキソ 酪酸、 4 ー (3 . 4 . 5 ー トリメトキシフェニル)ー 4 ー オキン 酪酸、 4 ー (3 . 4 . 5 ー トリメトキシフェニル)ー 4 ー オキソ 酪酸、 4 ー パラクロロフェニルー 4 ー オキソ 酪酸 又はこれらてーケト酸のメチルエステル 物酸 又はこれらてーケト酸のメチルエステル 化合物 が挙げられる。

触媒として用いられる光学活性ルテニウムーホスフィン錯体としては、例えば次の(1)~(3)で表わされる化合物が挙げられる。

## (1) 一般式(皿)

で表わされる三极ホスフィン(ここで、 R\*は前記 と同じ意味を示す)を示し、 R\*は低級アルキル基、 ハロゲン化低級アルキル基又はフェニル基を 示す。)

## (3) 一般式(VI)

$$[RuX]_{0}^{R*}P-R*)(R*-BINAP)]_{*}(\mu-X)_{*}$$
 (VI)

(式中、X はハロゲン原子を示し、R\*及びR\*は同 ー又は異なって置換基を有してもよいフェニル基 を示し、R\*-BINAPは一般式(VII)

で表わされる三級ホスフィンを示し、ここでR'は 水素原子、メチル基、tert~ブチル基又はメトキ シ基を示す。)

で表わされる化合物等が挙げられる。

(1)の一般式 (皿) で表わされる光学活性ルテニウムーホスフィン錯体は、例えばJ. Chem. Soc.. Chem. Commun.. P. 922 (1985) 又は特開昭 61-63690号公報で開示されている方法により得ることができる。一般式 (皿) の錯体の具体例としては、Ru \*Cl\*(BINAP)\*(NBt\*)(式中、BINAP は 2.2′ーピス (ジフェニルホスフィノ) ー1. 1′ーピナフチルを示し、Btはエチル塞を示す。)、

ゥムーホスフィン錯体は、例えば次の一般式 (VE)

$$\{RuX(\frac{R^{5}}{R^{5}}P-R^{4}), \{dma\}\}, \{\mu-X\}, \{VII\}$$

(式中、R®、R®及びX は前記と同じ意味を有し、dma は N 、 N ージメチルアセトアミドを示す。)で表わされるルテニウムーホスフィン雑体から合成することができる。

ここで、一般式(VI)及び一般式(VII)で表わされるルテニウムーホスフィン錯体のR®及びR\*は同一又は異なって更換基を有しても、例えばフェニル基、その具体例としては、例チルルでは、のアルニニルをのアルキーンフェニルを、クーメトキンフェニルを、クージメチルでは、フェニルをのジアルキルで、フェニルをのジアルキルで、フェニルをのジアルキルで、フェニルをのジアルを、クージスチルでは、フェニルをのジアルキルで、フェニルをのジアルキルで、フェニルをのジアルキルで、フェニルをのジアルキルで、フェニルをのジアルキルで、ファニルをのジアルキルで、ファニールをのジアルキルで、ファニーのジアルキルで、ファニーのジアルキルで、ファニールをのジアルキルで、ファニーのジアルキルで、ファニーのジアルキルで、フィージャルをでは、ファニーのジアルキルで、ファニーのジアルキルで、ファニーのジアルキルで、ファニーのジアルキルで、ファニーのジアルキルで、ファニーのジアルキルで、ファニーのジアルキルで、ファニーのジアルキルで、ファニーのジアルキルで、ファニーのでは、ファニーのでは、ファートのでは、ファールーのでは、ファートのでは、ファートのでは、ファートのでは、ファートのでは、ファートのでは、ファートのでは、ファートのでは、ファートのでは、ファールーのでは、ファートのでは、ファートのでは、ファールのでは、ファートのでは、ファートのでは、ファートのでは、ファールのでは、ファートのでは、ファールのでは、ファールのでは、ファールのでは、ファート

Ru,Cl,(p-Tol-BINAP),(HBL,)(式中、p-Tol-BINAP は、2. ビービス(ジーロートリルホスフィノ)ー1. ビービナフチルを示す。)、RuHCl(BINAP),客が挙げられる。

(2)の一般式 (V) で表わされる光学活性ルテニ ウムーホスフィン錯体は、例えば特開昭 62 -265293号公報で開示されている方法により得るこ とができる。一般式 (V) の錯体の具体例として

t Ru(BINAP) (OCCH 1) 2 Ru(BINAP) (OCCF 1) 2 .

United Ru (p-Toi-BiNAP) (OCCF。)。、Ru (BINAP) (OCt-Bu)。 (式中、t-Buはtertーブチル基を示す。)、

Ru (B [ NAP) (OC Ph)。 (式中、Phはフェニル基を示す。)等が挙げられる。

(3)の一般式 (VI) で表わされる光学活性ルテニ

ェニル基等が挙げられる。

一般式(VII)で表わされる化合物のうちR\*及びR\*がフェニル基であるところの錯体は、例えば次のごとくして製造することができる。 X が塩素原子の場合、即ち、

[Rucl (PPh,):(dma)]:(μ-Cl):は例えば、文献

[. S. Thorburn, S. J. Rettis, B. R. James;
Inors. Chem., 25色, 234-240 頁 (1986年) の方
住により顕製した[Rucl:(PPh:)(dma)](dma)を原
料とし、これをヘキサン中、60~90℃で1~20時
間反応せしめた後、室選まで冷却し、カラスフィ
ルターで速過後、ヘキサンで洗浄し、次いで乾燥
することにより定量的に合成することができる。

 $[RuCl\ (PPh_*)_*, (dma)]_*, (\mu-Cl)_*$ を中間体として 一般式 (VI) で表わされる化合物のうち、 $R^*$ 及び $R^*$ がフェニル基、 $R^*$ が水条原子、X が塩素原子であるところの錯体、即ち

さらに、斯くして得られた

[RuCl (?Ph.) (31 NAP)]. (μ-Cl).は例えば次のごとくして製造することができる。

## 特間平4-108782(5)

即ち、 $\{RuCl(PPh_1), (dna)\}, (\mu-Cl),$ 譜体と BIMAP とそクロロベンゼン、コージクロロベンゼン、塩化メチレン、1.2- ジクロロエタン等の 格紙中、 $50\sim100$  で  $5\sim20$  時間反応せしめた後、格紙を被圧下にて留去することにより定量的に合成することができる。

また、上述と同様な製造方法に従って、原料の 種類を変えれば(3)に含まれる次の光学居性ルテニ ウムーホスフィン館体を合成することができる。 [RuCl (PPh<sub>2</sub>) (p-Toi-BINAP)]<sub>2</sub> (μ-Cl)<sub>2</sub> [RuCl (PPh<sub>2</sub>) (p-WeO-BINAP)]<sub>3</sub> (μ-Cl)<sub>2</sub> [RuCl (PPh<sub>3</sub>) (p-t-Bu-BINAP)]<sub>4</sub> (μ-Cl)<sub>3</sub> [RuBr (PPh<sub>3</sub>) (BINAP)]<sub>4</sub> (μ-Br)<sub>5</sub> [RuBr (PPh<sub>3</sub>) (p-Toi-BINAP)]<sub>4</sub> (μ-Br)<sub>5</sub> [RuBr (PPh<sub>3</sub>) (p-MeO-BINAP)]<sub>4</sub> (μ-Br)<sub>5</sub>

以下余白

尚、上記式中に示される略号は以下の意味を有する。

Ph:フェニル基 We:メチル基 [RuSr(PPh<sub>2</sub>) (p-t-8u-8INAP)]<sub>2</sub> (μ -8r)<sub>2</sub>

[RuI (PPh<sub>3</sub>) (8INAP)]<sub>2</sub> (μ -1)<sub>2</sub>

[RuI (PPh<sub>3</sub>) (p-ToI-8INAP)]<sub>2</sub> (μ -1)<sub>2</sub>

[RuI (PPh<sub>3</sub>) (p-MeO-8INAP)]<sub>2</sub> (μ -1)<sub>2</sub>

[RuI (PPh<sub>3</sub>) (p-t-8u-8INAP)]<sub>2</sub> (μ -Cl)<sub>2</sub>

[RuCl (P←O-Ne)<sub>2</sub>) (8INAP)]<sub>2</sub> (μ -Cl)<sub>2</sub>

[RuCl (P←O-Ne)<sub>3</sub>) (p-ToI-8INAP)]<sub>3</sub> (μ -Cl)<sub>2</sub>

[RuCl (P←O-Ne)<sub>3</sub>) (p-MeO-8INAP)]<sub>3</sub> (μ -Cl)<sub>2</sub>

[RuCl (P←O-Ne)<sub>3</sub>) (p-t-8u-8INAP)]<sub>3</sub> (μ -Cl)<sub>3</sub>

NeO

[RuCl (P←O-Ne)<sub>3</sub>) (8INAP)]<sub>2</sub> (μ -Cl)<sub>3</sub>

NeO [RuCl (P-() ), ) (p-ToI-BIHAP)], (μ-Cl),

p-t-Bu-B[NAP: 2. 2'ーピス(ジーp-tertー ブチルフェニルホスフィノ)ー 1. 1'ーピナフチル

 [発明の効果]

本発明は確々のフェロモンとして、また香料として重要な光学活性「ーブチロラクトン誘導体を簡単に、工程致少なく、さらに光学純度良く製造する方法を提供する工業的に育利なものである。 (実施例)

以下、実施例により本発明を更に詳細に説明するが、本発明はこれら実施例に限定されるものではない。

## 実施例1

(R) - 4 - メチルーァーブチロラクトンの 合成:

注入口温度:190℃

キャリアーガス: ヘリウム

以下の実施例においても同様な方法及び条件で 光学純度を決定した。

#### 実施例2

(R) - 4 - メチルー r - ブチロ ラクトンの 合成:

100mlのオートクレーブにレブリン酸メチル
1、18g(10mmol) 及びメタノール15mlを入れ、窒素
気流下でRuzCl。((R)-BINAP) aNEt。169mg(0.1
mmol) を加えて、水素圧100kg/cd、50でで20時間水素化を行った。熔媒を留去後、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサンージェチルエーテル)で触媒を除去した後、得られた溶液を130でで3時間加熱し、窒温にもどした後、ジェチルエーテル4元で希釈した。この溶液を艶和炭・水素ナトリウム水溶液3元で洗浄し、無水硫酸ナトリウムを減
けトリウムで乾燥した。無水硫酸ナトリウムを減
引し、減液を減圧下濃縮して得た粗生成物を減圧

ジェチルエーテル4 配で希訳した。この俗核を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液3 配で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。無水硫酸ナトリウムを確別し、減液を練圧下濃縮して得た粗生成物を破圧下蒸留し、(R) - 4 - メチルーァーブチロラクトン1.3g (収率88%) を得た。

b. p. =  $90 \sim 100 \, \text{T} / 25 \, \text{mmHg}$ 

 $(\alpha)_{n}^{16} = +35.8^{\circ} (C=1.44, CH_{2}Cl_{2})$ 

'H-NMR (400 MHz. CDCl 3. δ ppm) :

1. 42 (d. 3 H. J=6. 4 Hz), 1. 84 (ddt. 1 H. J=7. 9 Hz, J=9. 4 Hz, J=12. 4 Hz), 2. 30-2. 50 (m. 1 H), 2. 50-2. 60 (m. 2 H), 4. 66 (ddq. 1 H.

J=6. 2Hz, J=6. 4Hz, J=7. 9Hz)

光学純度は光学活性キャピラリーカラムを用い、 ガスクロマトグラフィー法により 99.46% eeと快 定した。

以下、その分析条件(GLC)を示す。

カラム:Lipodex® 8. (Wacherey-Nagel社製) 25m fused Silica

カラム温度: 150℃

ン0.7g(収率70%)を得た。光学純度98% ee。

 $[\alpha]_0^{16} = +36.2$  (C=1.44, CH<sub>2</sub>Ce<sub>3</sub>)

#### 実施例3

(S)- 4 - メチルーァーブチロョクトンの 合成:

触媒をRu,Cl,((R)-BINAP),NBt,の代わりに
Ru,Cl,((S)-BINAP),NBt,とした他は実施例 2 に 体じて、実験を行い、(S)-4-メチルーァーブチロラクトン0.7g (収率70%)を得た。光学純度
98% ass

b. p. = 90~ 100 t / 25mmHg

 $[\alpha]_{a}^{1*} = -36.2^{\circ} (C=1.44. CH_{2}C\ell_{2})$ 

'H-NMR (400MHz, CDCL s, 8 ppm) :

1. 42 (d. 3H, J=6. 4Hz), 1. 84 (ddt. 1H, J=7. 9Hz, J=9. 4Hz, J=12. 4Hz), 2. 30-2. 50 (m. 1H), 2. 50-2. 60 (m. 2H), 4. 66 (ddq. 1H.

J=6.2Hz, J=6.4Hz, J=7.9Hz)

#### 実施例 4

## 特開平4-108782(ア)

100mlのオートクレーブに 4 ーフェニルー 4 ーオキソ酢酸 i. 78g(10mnol) 及びエタノール i4mlを入れた。別途エタノール 5 mlに

Ru((R)-p-To1-8[NAP)(OCCH<sub>3</sub>): 44.9 ag (0.05 mnol) とこの触媒に対して2倍モルの濃塩酸を加えた溶液を調整し、この溶液を先のオートクレーブに窒素気流下で加え水素圧70kg/cd、35℃で230時間水素化を行った。この反応液に水酸化ナトリウムの10%溶液8配を加え、40℃で3時間提拌し、窒温にもどした後、この溶液を塩化メチレン30配で2回抽出し、有機層を除いた後、水層を10%塩酸水溶液でpH4とした後再び塩化メチレン20配で3回抽出した。合わせた抽出液を濃縮し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサンージェチルエーテル)で精製し、(S)ー4ーフェニルーアーブテロラクトン1.02g(収率63%)を得た。光学純度96.7%ee。

b. p. =  $85 \sim 95 \, \text{T} / 0.1 \, \text{mmHg}$   $(\alpha)_0^2 = -31.4^{\circ} (C=3.88, CHCL_3)$  $^1\text{H-NMR}(400 \, \text{MHz}, CDCL_2, \delta \, \text{ppm})$ : 1.8-3.0 (m. 4H.CH.CH.). 5.57 (t. 1H. J=7Hz. CH). 7.45 (s.5H.Ph)

## 実施例5~8

基質である r ー z キ ソ 酸又はそのエステル及び 基質/触媒モル比、温度、時間、熔媒の反応条件 を下記の表 i のように変え、又、水素圧を 70 kg / cd の代わりに 100 kg / cd とした他は実施例 4 に な じて実験を行い各生成物を得た。

以下余白

表 1

実施例	基 質	生 成 物	収率(%)	光学純度 (%ee)	反吃条件			
					S/C	温度 (で)	時間(hr)	客 煤
5	レブリン酸ェチル	(R) ー 4 ーメチルーァー ブチロラクトン	93	99, 5	600	25	. 110	エタノール
6	4ーオキソドデカン酸エチル	(R) - 4 - オクチルード ープチロラクトン	90	98. 1	400	35	118	エタノール
7	4ーフェニルー4ーオキソ酪 酸エチル	(S) - 4 - フェニルー r ープチロラクトン	60	96. 7	350	35	258	エタノール
8	4 — (3、4、5 — トリメト キシフェニル) — 4 — オキソ 酪酸メチル		50	95. 5	300	35	240	メタノール

表中、S/Cは基質/触媒モル比を示す。

# 特開平4-108782(8)

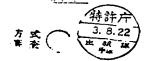
#### 手 読 補 正 書(自発)

平成3年8月21日

#### 特許庁長官 深 沢 亘 殿



- 1. 事件の表示 平成2年特許顕第228957号
- 2. 発明の名称 光学活性ャープチロラクトン誘導体の製造方法
- 3. 補正をする者事件との関係 出版人名称高砂香料工業株式会社
- 4. 代理人 住所 東京都中央区日本橋人形町1丁目3番6号(〒103) 共同ビル 電話(3669)090(本内電話) 氏名 (6870) 弁理士 有置 三 幸福(日本) 住所同 上 氏名 (7756) 弁理士 高野 登志雄 住所同 上 氏名 (9673) 弁理士 中 編役 夫 5. 補正命令の日付 目発



6. 補正の対象

明細書の「発明の詳細な説明」の概

- 7. 補正の内容
  - (1) 明細書中、第12頁第11行

O II (Ru(p-Tol-BINAP)(OCH.).] とあるを

「Ru(p-Tol-BINAP)(OCCH<sub>\*</sub>),」と打正する。

: (2) 同、第14頁第9行 「[RuC4 (PPh.)(dma)](dma)」とあるを 「[RuC4 (PPh.)(dma)](dma)」と訂正する。